

第5回講習会

「X線反射率による薄膜・多層膜の解析」

2015年8月27日(木) 9:00~16:30

物質・材料研究機構 千現地区 (茨城県つくば市)

主催 (公社)応用物理学会 埋もれた界面のX線中性子解析研究会
<http://www.nims.go.jp/xray/ref/>

X線反射率法は、薄膜・多層膜の深さ方向の内部構造、具体的には、各層の膜厚、密度、各界面のラフネス等を非破壊的に求めることができる解析技術です。本講習会では、X線反射率法の経験豊富な専門家を講師陣に迎え、基礎から丁寧に解説を行うとともにシミュレーションやデータ解析の実習を少人数のグループにて、きめ細かく行ないます。休憩時間には「X線反射率相談デスク」を設け、日頃の疑問に思っていること、質問したくてもなかなかできなかったことに、6名の専門家がお答えします。

08:30	開場、受付開始	
09:00 -09:10	X線反射率法とは	桜井健次(物材機構)
09:10 -10:00	X線反射率法の基礎	淡路直樹(富士通)
10:00 -10:40	X線反射率の測定装置・方法	表和彦(リガク)
10:40 -11:00	休憩 (X線反射率相談デスク)	
11:00 -11:40	半導体・電子材料への応用	川村朋晃(日亜化学)
11:40 -12:20	磁性体多層膜への応用	上田和浩(日立)
12:20 -13:20	昼食休憩 (X線反射率相談デスク)	
13:20 -14:00	反射小角散乱法による材料研究	奥田浩司(京大)
14:00 -16:30	X線反射率法のデータ解析実習	

「X線反射率法入門」(講談社、5940円)を参考書として配布するほか(ご希望があれば、着払い宅急便にて事前送付も致します)、すべての講義に完全対応したレジュメを用意いたします。

実習は、A. 経験者コース(担当 表和彦 6名程度まで)、B. 解析体験コース(担当 淡路直樹 12名程度まで)、C. 初学者コース(担当 桜井健次 12名程度まで)に分かれて実施します。特にご希望のない場合も、個別にお話をうかががい、ご相談の上、最適のコースを決めさせていただきます。

定員 30名

申し込み方法 氏名(ふりがな)、所属、住所、TEL、FAX、e-mail、実習コース(A, B, C)のご希望をご連絡下さい。折り返し受付の連絡をいたします。

連絡先 独立行政法人物質・材料研究機構
高輝度光解析グループ 桜井健次
TEL 029-859-2821 FAX 029-859-2801
e-mail SAKURAI.Kenji@nims.go.jp

